

氏名	大塚 知津子
よみ	おおつか ちづこ
英字	Ohtsuka, Chizuko
オフィスアワー	前期は月曜日と火曜日13:00～14:30、後期は月曜日13:00～15:00 email:ohtsuka-c@mizuho-c.ac.jp
プロフィール	時習館高校卒業、名古屋大学工学部合成化学科卒業
	名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了、名古屋大学大学院工学研究科博士課程満了
職位	理事長、学長、教授
最終学歴	名古屋大学大学院工学研究科（博士課程）単位取得満期退学、名古屋大学大学院工学研究科研究生
学位	工学博士
所属学会・役職	日本化学会、日本分析化学会、クロマトグラフィー科学会
専門分野	分析化学
研究テーマ	機器による金属錯体およびキレート試薬の分析
主な教育・研究及び社会的活動及び業績	<p>C. Shibata, M. Yamazaki and T. Takeuchi</p> <p>Quantitative Analysis of polybutadiene by means of Pulse FT Carbon-13 NMR</p> <p>Bull. Chem. Soc. Jpn. , 50(1977)311.</p> <p>C. Ohtsuka, H. Wada and G. Nakagawa</p> <p>Reversed-phase ion-pair partition liquid chromatography of chelates with</p> <p>2-(3,5-dibrom-2-pyridylazo)-5-[N-ethyl-N-(3-sulphopropyl)amino]-phenol and analogues</p> <p>Anal. Chim. Acta, 223(1989) 339.</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, K. Matsuzawa and G. Nakagawa</p> <p>Chromatographic behaviour of 2-(2-pyridylazo)-5-[N-(sulphoalkyl)amino]-phenol chelates on hydrophobic stationary phases</p> <p>Anal. Chim. Acta, 252(1991) 181.</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, K. Matsuzawa and G. Nakagawa</p> <p>Characterization of 2-(2-pyridylazo)-5-[N-(sulphoalkyl)amino]-phenol derivatives as the pre-column chelating agent for trace metal determination by ion-pair reversed-phase liquid chromatography with spectrophotometric detection</p> <p>Anal. Chim. Acta, 256(1992)91.</p> <p>H. Wada, M. matsushita, T. Yasui, A. Yechi, H. Yamada, G. Nakagawa and C. Ohtsuka,</p> <p>Ion chromatography of alkaline earth and heavy metal ions by on-column derivatization with bisazochromotropic acid</p> <p>J. Chromatogr., 657(1993) 87</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, and G. Nakagawa</p> <p>Retention behaviour of metal chelates in ion-pair reversed phase liquid chromatography as a function of mobile phase composition with methanol/water and acetonitrile/water mobile phases</p> <p>Anal. Chim. Acta, 294 (1994) 69.</p> <p>C. Ohtsuka, Y. Mori, S. Hayashi, T. Tsuda and H. Wada</p> <p>Estimation of hydrophobicity using quasi-molecular volume of quaternary ammonium ions</p> <p>J. Liq. Chromatogr. & Related Tech., 23(5) (2000)669.</p>